

2010年11月18日

各 位

旭化成イーマテリアルズ株式会社

## ArF 露光対応ペリクルの上市と生産能力増強について

～ 国内唯一の全露光光源対応のラインナップを実現～

旭化成イーマテリアルズ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:鴻巣 誠)は、この度、半導体用途向けの ArF (フッ化アルゴン) 露光対応ペリクル を上市するとともに、生産技術の革新により半導体用途ペリクルの生産能力を倍増させ、今後の半導体製造プロセスの更なる微細化に伴う最先端ペリクルの需要に十分対応可能な供給体制を整えましたので、お知らせします。

ペリクル...半導体や液晶パネルの露光工程において、微細パターンが描かれたフォトマスクに塵が付着しシリコンウェハーやパネル基板に結像するのを防ぐために、フォトマスクのカバーとして使用される防塵保護膜。

### 1. 背景

当社は、液晶パネルフォトマスク用ペリクルについて世界一のシェアを持ち、最大サイズである第 10 世代対応ペリクルの唯一の供給メーカーです。また、当社は、半導体フォトマスク用ペリクルについても、従来型の g 線 i 線露光用ペリクルから半導体の配線パターンの微細化ニーズに対応した KrF (フッ化クリプトン) 露光用ペリクルまで、広く顧客ニーズに対応できる製品ラインナップを取り揃えています。

一方、近年の半導体製造工程では、超微細加工技術が高度化する中で、露光光源も可視光線である g 線、紫外線の i 線から、より微細なパターンを転写することが可能となる KrF、ArF といったレーザー光の短い波長の光源へと移行してきました。

当社では、こうしたニーズに対応するため、今回 ArF 露光対応ペリクルを上市し、全露光光源対応のラインナップをもつ国内唯一のサプライヤーとなりました。更に、宮崎県延岡市の半導体用途向けペリクル製造設備の生産能力を、生産技術の革新により従来比倍増の 22 万枚/年とすることにより、更なる安定供給体制を整えました。

当社は、今回の ArF 露光対応ペリクルの上市および生産能力増強により、高度化する IT 機器に対応するため今後とも最先端の製品供給を行い、顧客ニーズに応え情報化社会の進展に貢献していきます。

### 2. 今回上市の ArF 露光対応ペリクルの特長

- (1) 優れた耐久性と高い透過率を得られる膜設計
- (2) 高いクリーン化技術により、異物を最小限に抑制
- (3) リソグラフィ工程の歩留まり向上に貢献

### 3. 生産設備概要

- (1) 所在地 宮崎県延岡市
- (2) 生産内容 半導体用途ペリクル
- (3) 設備能力 22 万枚/年(能力増強後)
- (4) 操業計画 2010 年 10 月

以 上